

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成30年9月13日(2018.9.13)

【公開番号】特開2017-112234(P2017-112234A)

【公開日】平成29年6月22日(2017.6.22)

【年通号数】公開・登録公報2017-023

【出願番号】特願2015-245747(P2015-245747)

【国際特許分類】

H 01 L 21/312 (2006.01)

H 01 L 29/786 (2006.01)

C 08 F 220/56 (2006.01)

H 01 B 3/44 (2006.01)

H 01 B 17/56 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/312 A

H 01 L 29/78 6 1 7 T

C 08 F 220/56

H 01 B 3/44 Z

H 01 B 17/56 L

【手続補正書】

【提出日】平成30年8月6日(2018.8.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項4】

共重合体(A)中、 - 不飽和化合物(a1)由来のアミド基のモル数(X)と、活性水素基を有する - 不飽和化合物(a2-1)由来の活性水素基のモル数(Y)との当量比(X)/(Y)が、1以上であることを特徴とする請求項2または3に記載の絶縁膜形成用組成物。